⑵　上記⑴により求められた差が調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記⑴で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記⑴により求められた差が再び調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、上記４及び５の操作により試験し直す。

別表第５の２⑴中「超音波噴霧装置を備えたもの」を削り、同表の４⑴中「又は分析装置による自動添加」を削り、同表の５中「メスフラスコ」の下に「４個以上」を「50mlとする。」の下に「この場合、調製した溶液のそれぞれの金属の濃度は、表２に示す濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。」を加え「なお、内部標準液の添加は、試験溶液と同様とする。」を削り、同表の５の次に次のように加える。

６　空試験

精製水を一定量採り、以下上記４⑴及び⑵と同様に操作してそれぞれの金属の濃度を求め、表２に示す濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記４⑴及び⑵と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

７　連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

⑴　おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記５で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度（以下この７において「調製濃度」という。）に調製した溶液について、上記４⑵に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

⑵　上記⑴により求められた差が調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記⑴で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記⑴により求められた差が再び調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、上記４及び５の操作により試験し直す。

別表第６の４⑴中「又は分析装置による自動添加」を削り、同表の５中「メスフラスコ」の下に「４個以上」を「一定量とする。」の下に「この場合、調製した溶液のそれぞれの金属の濃度は、表２に示す濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。」を加え「なお、混合内部標準液の添加は、試験溶液と同様とする。」を削り、同表の５の次に次のように加える。

６　空試験

精製水を一定量採り、以下上記４⑴及び⑵と同様に操作してそれぞれの金属の濃度を求め、表２に示す濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記４⑴及び⑵と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

７　連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

⑴　おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記５で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度（以下この７において「調製濃度」という。）に調製した溶液について、上記４⑵に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

⑵　上記⑴により求められた差が調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記⑴で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記⑴により求められた差が再び調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、上記４及び５の操作により試験し直す。

別表第７の５中「分解容器」の下に「４個以上」を「一定量とする。」の下に「この場合、調製した溶液の水銀の濃度は、上記４⑴に示す検水の濃度範囲を超えてはならない。」を加え、同表の５の次に次のように加える。

６　空試験

精製水を一定量採り、以下上記４⑴及び⑵と同様に操作して水銀の濃度を求め、上記４⑴に示す検水の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記４⑴及び⑵と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

７　連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

⑴　おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記５で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度（以下この７において「調製濃度」という。）に調製した溶液について、上記４⑵に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

⑵　上記⑴により求められた差が調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記⑴で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記⑴により求められた差が再び調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、上記４及び５の操作により試験し直す。

別表第８の５中「メスフラスコ」の下に「４個以上」を「20mlとする。」の下に「この場合、調製した溶液のセレンの濃度は、上記４⑴に示す検水の濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。」を加え、同表の５の次に次のように加える。

６　空試験

精製水を一定量採り、以下上記４⑴及び⑵と同様に操作してセレンの濃度を求め、上記４⑴に示す検水の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記４⑴及び⑵と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。

７　連続試験を実施する場合の措置

オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、以下に掲げる措置を講ずる。

⑴　おおむね10の試料ごとの試験終了後及び全ての試料の試験終了後に、上記５で調製した溶液の濃度のうち最も高いものから最も低いものまでの間の一定の濃度（以下この７において「調製濃度」という。）に調製した溶液について、上記４⑵に示す操作により試験を行い、算定された濃度と調製濃度との差を求める。

⑵　上記⑴により求められた差が調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、是正処置を講じた上で上記⑴で行った試験の前に試験を行ったおおむね10の試料及びそれらの後に試験を行った全ての試料について再び分析を行う。その結果、上記⑴により求められた差が再び調製濃度の±10％の範囲を超えた場合には、上記４及び５の操作により試験し直す。

別表第９の５中「メスフラスコ」の下に「４個以上」を「20mlとする。」の下に「この場合、調製した溶液のセレンの濃度は、上記４⑴に示す検水の濃度範囲から算定される試験溶液の濃度範囲を超えてはならない。」を加え、同表の５の次に次のように加える。

６　空試験

精製水を一定量採り、以下上記４⑴及び⑵と同様に操作してセレンの濃度を求め、上記４⑴に示す検水の濃度範囲の下限値を下回ることを確認する。

求められた濃度が当該濃度範囲の下限値以上の場合は、是正処置を講じた上で上記４⑴及び⑵と同様の操作を再び行い、求められた濃度が当該濃度範囲の下限値を下回るまで操作を繰り返す。